

รายการอ้างอิง

1. Madelung , O., Semiconductor Group IV Element and III-V Compound, pp. 26.
n. p. : Springer-Verlag., 1992.
2. Rocktt , A., and Birkmire , R.W. J. Appl. Phys. 70 (1991) : R81-R97.
3. Nanto , H., Minami , S., and Takata , S. J. Appl. Phys. 4 (1984) : 1029-1034.
4. Chopra , K.L., Major , S., and Pandya , D.K., Thin Solid Films.
102 (1983) : 1-46.
5. Bunshah , R.F., and other., Deposition Technologies for Films and Coating :
Development and application. New Jersey : Noyes. , 1982.
6. Vossen , J.L., and Kem , W., Thin Film Processes II., Sandago : Academic
Press. , 1991.
7. Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching.,
New York : John Wiley & Son. , 1980.
8. Granqvist , C.G., and Niklasson. , G.A. , Thin Film Technology, pp. 45.
Gothendurg : Physics Department Chalmer University of Tecnology,
n. d.
9. Vossen , J.L., and Kem , W., Thin Film Processes II., pp. 20. Sandago :
Academic Press., 1991.
- 10 Granqvist , C.G., and Niklasson , G.A. , Thin Film Tecnology, pp. 48.
Gothendurg : Physics Department Chalmer University of
Tecnology, n. d.
11. ธนุสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน " การเตรียมฟิล์มบางโดยวิธีแมกนีตรอนสปัตเตอริง "
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538.
- 12 Ohring , M., The Materials Science of Thin Films., pp. 51-53. San Diego :
Academic Press., 1992.

- 13 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 2. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 14 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 51-52. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 15 Ohring , M., The Materials Science of Thin Films., pp. 106. San Diego : Academic Press., 1992.
- 16 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 55. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 17 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 57. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 18 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 80. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 19 Maniv , S., and Wastwood, W.D., J. Appl. Phys., 53 (1982) : 356-360.
- 20 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 115-123. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 21 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 124-125. New York : John Wiley & Son, Inc., 1980.
- 22 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 23. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 23 Ohring , M., The Materials Science of Thin Films., pp. 108-109, San Diego : Academic Press., 1992.
- 24 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 143-146. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 25 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 155. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 26 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etching., pp. 153-155. New York : John Wiley & Son., 1980.

- 27 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etcing., pp. 156-158. New York : John Wiley & Son. , 1980.
- 28 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etcing., pp. 168. New York : John Wiley & Son. , 1980.
- 29 Ohring , M., The Materials Science of Thin Films., pp. 124. San Diego : Academic Press. , 1992.
- 30 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etcing., pp. 263. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 31 Ohring , M., The Materials Science of Thin Films., pp. 112-113. San Diego : Academic Press , 1992.
- 32 Wasa , K. Sputtering Techniques and application., in Chopra , K.L. and Malhotra , L.K. (ed.), Thin Film Technology and Applications Proceeding of the International Workshop on Thin Film Technology and Applications. November 19-30 New Delhi, India., pp. 40-41. New Delhi : McGraw-Hill Publishing company Limited, 1984.
- 33 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etcing., pp. 241-242. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 34 Chopman , B., Glow Discharge Processes : Sputtering and Plasma Etcing., pp. 243. New York : John Wiley & Son., 1980.
- 35 Ohring , M., The Materials Science of Thin Films., pp. 126-128. San Diego : Academic Press., 1992.
- 36 Pliskin , W.A. and S.J. , Zanin, in L.I. , Maissel and R. , Glang, Handbook of Thin Film Tcehnology, pp. 11.1-11.54. New York : McGraw-Hill, 1970.
- 37 Runyan , W.R., Semiconductor Measument and Instrumentaion, pp. 175-178. Bombay : McGraw-Hill, 1975.

- 38 สมฤทธิ์ วงคมนิโรจน์ * ระบบวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์ความ
คมโดยคอมพิวเตอร์ * วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538.
- 39 Runyan , W.R., *Semiconductor Measurement and Instrumentation*, pp. 67-75.
Bombay : McGraw-Hill, 1975.
- 40 Sze , S.M., *Physics of Semiconductor Devices.*, pp. 30-38. 2 nd ed. New York
: John Wiley & Son, 1981.
- 41 Cullity , B.D., *Element of X-Ray Diffraction.*, pp. 1-176. 2nd ed.
Massachusetts : Addison-Wesley 1978.
- 42 Holt , D.B. and Joy , D.C., *SEM Microcharacterization of Semiconductors.*,
London : Academic Press , 1989.
- 43 Greenaway , D.L. and G , Harbeke, *Optical Properties and Band Structure of
Semiconductors*, pp. 5-33. n. p. : Pergamon Press, 1988.
- 44 Johnson , E.J., In R.K. Willardson and A.C. Beer (eds.), *Semiconductor and
Semimetals*(Vol. 3) , pp. 153-194. , New York : Academic Press,
1967.
- 45 C. A. , Aita , et al. *J. Appl. Phys.* 51 (1980) : 5533-5536 .
- 46 T. , Minami, et al. *Jpn. J. Appl. Phys.*, 24 (1985) : L781-L784
- 47 H. , Yoshikava, and S. , Adachi, *Jpn. J. Appl. Phys(Part 1)*, 36 (1997) :
6237-6243.
- 48 P. , Blood., and J. W. , Orton., *The Electrical Characterization of Semiconductor
: Majority Carriers and Electron States* , pp. 13-92. London :
Academic Press , 1992.
- 49 Leonard. , G. , Berry., et al. , *Selected Powder on Diffraction Data for Minerals
Databook*(1 ed.) , pp. 26 Joint Committee on Powder Diffraction
Standards : Pennsylvania , n. d.

ประวัติผู้เขียน

นาย คมกฤษณ์ ปุณอุดม เกิดวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2515 ที่จังหวัดกรุงเทพฯ
สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา 2536 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2537



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย